(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年6月9日(09.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/052085 A1

(51) 国際特許分類7: C09J 201/00, 11/06, H01L 21/68

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017449

(22) 国際出願日:

2004年11月25日(25.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-397871

2003年11月27日(27.11.2003)

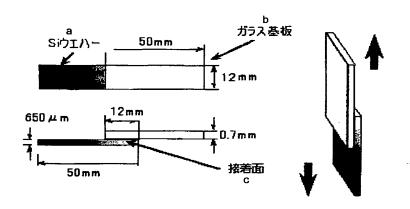
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1040045 東 京都中央区築地五丁目6番10号 Tokyo (JP).

- (71) 出願人(米国についてのみ): 横山 路子(YOKOYAMA、 Michiko) (発明者(死亡)の相続人) [JP/JP]; 〒5121216 三重県四日市市桜花台二丁目35番15号 Mie (JP).
- (72) 発明者: 横山 泰明 (YOKOYAMA, Yasuaki) (死亡).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 保田 慶友 (YA-SUDA, Kyouyu) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区築地 五丁目6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP), 伊藤 信幸 (ITOU, Nobuyuki) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央 区築地五丁目6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP).

/続葉有/

(54) Title: HOT MELT ADHESIVE COMPOSITION

(54) 発明の名称: ホットメルト型接着剤組成物



- a Si WAFER
- **GLASS SUBSTRATE**
- **c** BONDING FACE

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide an adhesive composition employed to fix a semiconductor wafer or the like onto a support base, which adhesive composition exhibits firm adherence of high thermal stability at the time of grinding operation but after the completion of grinding operation, is melted by heating to thereby permit easy detachment. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] There is provided a hot melt adhesive composition comprising as a main component a crystalline compound of 50 to 300°C melting temperature, characterized in that the composition has a melting temperature width of 30°C or less and a melt viscosity of 0.1 Pa·s or below. It is preferred that the crystalline compound as the main component be an organic compound of 1000 or less molecular weight composed of C, H and O elements only, especially an aliphatic compound or alicyclic compound, and still especially a compound having a steroid skeleton and/or hydroxyl.

(57) 要約: [課題] 半導体ウエハーなどを支持基板に固定化する接着剤組成物であって、研削工程時においては堅固で高耐熱の接着能を有するとともに、研削工程終了後においては、加熱溶融することにより容易に剥離することが可能な接着剤組成 base, which adhesive composition exhibits firm adherence of high thermal stability at the time of grinding operation but after the



- (74) 代理人: 鈴木俊一郎(SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031 東京都品川区西五反田七丁目 1 3番6号 五反田山 崎ビル6階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。